2016年度 年 次 報 告

知の拠点あいち あいちシンクロトロン光センター



本冊子では、2016 年度に実施されました成果公開利用の成果報告と、施設の概要(光源加速器と共用ビームライン)、利用実績および利用促進活動実績についてまとめました。

光源加速器の運転は順調で、300mA の蓄積電流に対して、約 0.1%の精度でトップアップ運転を行っています。

供用開始当初は6本のビームラインでしたが、2015年度にBL1N2(軟X線 XAFS・光電子分光II)、2016年度にBL11S2(硬X線 XAFS II)が稼働して財団所有のビームラインが8本となりました。また、名古屋大学のBL2S1(単結晶X線回折)と愛知県のBL8S2(X線トポグラフィ)、更に、株式会社デンソー所有のBL2S3も加わり、当施設では11本のビームラインが稼働中です。

産業利用を主目的とするシンクロトロン光施設は、世界的に見て現時点でも希な存在として注目されていますが、産業利用の実績は供用を開始した2013年度で70%(産学協同利用を含む。財団所有ビームラインの実績)、2016年度でも65~70%となっています。最近の傾向として、大学の利用が目立って増えています。所属機関に関わらず利用は有償ではありますが、手厚い支援による使いやすさと年6回の募集など、研究計画が立てやすい運営形態が理解されて来たと思われます。多くのリピーターにご利用頂くと同時に新規利用者の開拓も私達の重要な使命と考えており、毎年約50機関に新たに参入して頂いています。

利用分野や利用企業の所在地などの詳細は利用実績にまとめられていますが、我が国の産業界の旺盛な利用は特筆に値すると思います。産業利用の視点で調査しましたアジアやヨーロッパのシンクロトロン光施設では、ビームタイムの10%程度を産業利用の目標に置いていることを考えますと、70%が如何に大きい割合であるかがわかります。2016年8月にドイツのカールス・ルーエ(放射光施設ANKAがある)で開催された国際会議(XAFS-16)では、産業利用のシンポジウムが企画され、あいちシンクロトロン光センターはディスカッションの基調講演として招待されました。

産業界の利用は成果非公開が、あいちシンクロトロン光センターの"売り"ですが、そのためどのような企業がどのような目的で利用しているかが全く見えません。2015年度まで文部科学省の「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業」として実施してきた企業等の成果公開無償利用を、2016年度では愛知県の事業として引き継いでおこないました。本冊子では、大学・公的機関による成果公開利用の成果を掲載し、成果公開無償利用事業については実験課題名、実施企業等を紹介しております。

利用者あっての供用施設ですので、ご利用とご提言を頂ければ幸いです。利用者の声は施設や 運営の改善に非常に重要です。できるだけご要望に応えたいと思いますので宜しくお願い申し上 げます。

2018年2月

公益財団法人 科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター 所長 竹田美和

1.	あり	15	シンクロ	トロン光センタ	一概要	至	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 1
	1.1	施詞	没概要 …				 	 	 2
	1.2	光》	原加速器				 •••••	 	 3
	1.3	201	7年10月月	見在の共用ビー	ムライ	`ン	 •••••	 	 4
2.	ユー	ーザ	一利用実統	漬			 	 	 ·· 15
	2.1	概》	兄				 	 	 16
	2.2	利月	用状況・扌	隹移	•••••		 	 	 16
3.	成男	 長報 4	告書		••••		 •••••	 	 19
	3.1	201	16 年度公	共等利用			 	 	 ·· 21
	3.1	1	BL1N2				 •••••	 	 21
	3.1	2	BL2S1				 •••••	 	 27
	3.1	3	BL5S1				 	 	 55
	3.1	.4	BL5S2				 	 	 87
	3.1	5	BL6N1				 	 	 107
	3.1	.6	BL7U				 	 	 129
	3.1	7	BL8S1				 	 	 151
	3.1	8	BL8S3				 	 	 171
	3.1	.9	BL11S2		•••••		 •••••	 	 195
	3.2	201	4年度・2	015年度公共等	利用		 	 	 205
	3.3	報台	告未提出 認	果題			 	 	 215
	3.4	201	6年度成身	果公開無償利用	事業		 	 •••••	 217
4.	外音	7発	表・利用値	足進			 	 	 219
	4.1	論	文発表 …				 	 	 220
	4.2	放射	付線業務領	 送事者教育訓練			 	 	 222
	4.3	シン	ンクロトロ	コン光利用者研究	究会		 	 	 224
	4.4	プロ	レスリリー	ース・新聞記事			 	 	 225

あいちシンクロトロン 光センター概要



1.1 施設概要

光源加速器は、50 MeV 直線加速器、1.2 GeV ブースターシンクロトロン、1.2 GeV 蓄積リングから成る。 超伝導偏向電磁石を 4 台導入することにより、最大 12 本のビームラインに硬 X 線を供給することも可能である。供用を開始した当初より、蓄積電流 300 mA のトップアップ運転を行っている。トップアップ運転中の電流値の変化は、300 mA に対して約 0.1 %である。

供用開始当初より 2014 年度まで、ビームライン 6 本で運用を行ってきた。ビームラインは、硬 X 線 XAFS I (BL5S1)、粉末 X 線回折・XAFS (BL5S2)、軟 X 線 XAFS・光電子分光 I (BL6N1)、真空紫外分光 (BL7U)、薄膜表面回折 (BL8S1)、広角・小角 X 線散乱 (BL8S3) である。2015 年度途中よりアルミニウム、マグネシウム等の軽金属の測定が可能な軟 X 線 XAFS・光電子分光 II (BL1N2) ビームラインと名古屋大学の単結晶 X 線回折(BL2S1)ビームラインが運用を開始し、2017 年の 1 月からは硬 X 線 XAFS II (BL11S2) ビームライン、2017 年の 6 月からは愛知県の X 線トポグラフィ(BL8S2) ビームラインが運用を開始し、現在、10 本の共用ビームラインで運用を行っている。

利用申し込みの募集は 2 か月ごとに行っている。 1 週間のうち、月曜日はマシンスタディ、火曜日から金曜日までがユーザー利用日を基本としており、1 日の利用は、 $10:00\sim14:00$ 、 $14:30\sim18:30$ の 2 シフト(1 シフト 4 時間)で行っている。

供用開始から 2016 年度までに、250 以上の企業・研究機関が利用しており、2 か月ごとの募集や計測サポートの充実などの利便性を反映し、ビームライン全体の平均利用率(利用シフト数/最大利用可能シフト数)は、2013 年度に 63.8%、2014 年度に 78.4%、2015 年度には 81.2%、2016 年度は 88.5%となった。特に、BL5S1、BL5S2、BL6N1 および BL7U については、2016 年度後半には利用率 100%に達している。

成果公開無償利用制度や測定代行、利用相談、セミナー・研究会を行い、新規ユーザーや新規課題の利用促進に関する取組を積極的に行っている。



1.2 光源加速器 (2017年10月現在)

蓄積リング

・電子エネルギー	$1.2~{ m GeV}$
・周長	72.0 m
・蓄積電流	300 mA 以上

・エミッタンス 約 53 nm-rad・RF 周波数 499.654 MHz

ハーモニック数 120

ブースターシンクロトロン

・入射エネルギー 50 MeV・出射エネルギー 1.2 GeV・周長 48.0 m

・エミッタンス 約 200 nm-rad
 ・RF 加速周波数 499.65 MHz
 ・加速繰り返し 単発~1 Hz

直線加速器

・電子エネルギー 50 MeV
 ・加速電荷量 1 nC
 ・パルス幅 <1 nsec
 ・加速繰り返し 単発~1Hz

・RF 周波数 2856 MHz

5T 超伝導偏向電磁石

・超伝導線材 NbTi-Cu・臨界温度 5.9 K

・冷凍機 2 段 4K-GM 冷凍機

・通電電流 約 100 A・電流密度(線材) 約 150 A/mm²

・ピーク磁東密度5.1 T

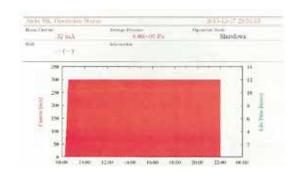
放射光臨界エネルギー 4.8 keV (1.2 GeV)

アンジュレータ (Apple-II)

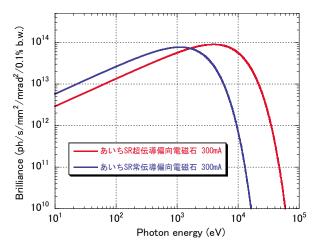
残留磁束密度1.3 T周期長60 mm周期数33最小ギャップ24 mm

K 値(最大)

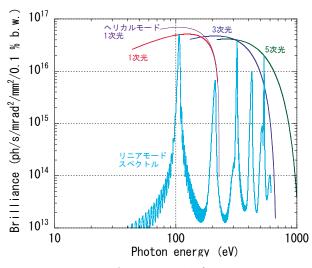
Linear (horizontal) 3.4 Linear (vertical) 2.0 Helical 1.7



蓄積電流値(22:00までの運転例)



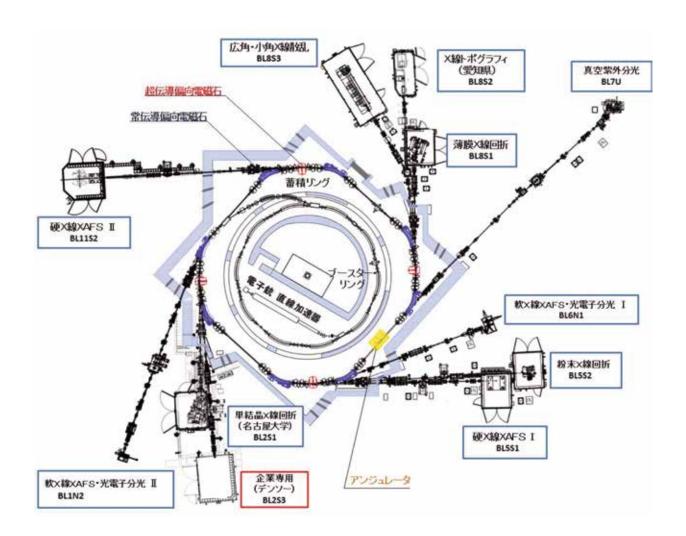
偏向電磁石光輝度



アンジュレータ光ブリリアンス

1.3 2017年10月現在の共用ビームライン

2017年度から新規ビームラインX線トポグラフィ(BL8S2)が供用開始した。2017年6月よりX線トポグラフィ、10月からX線 CT が新たに供用開始した。



(2017年10月現在)

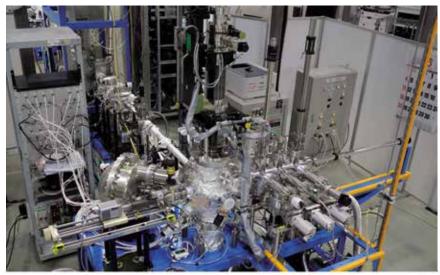
BL1N2 (軟 X 線 XAFS・光電子分光Ⅱ)

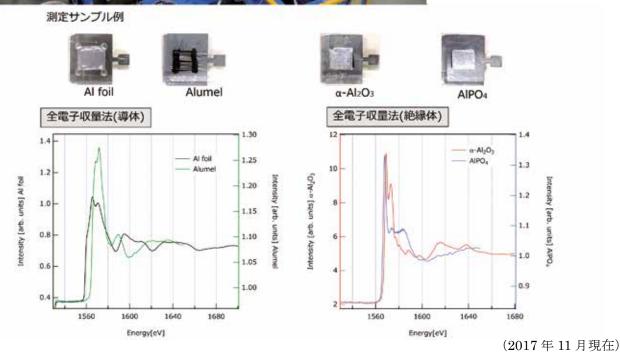
● 光エネルギー : 500~2000 eV (波長: 2.5~0.6 nm)

● ビームサイズ : 2×1 mm● 分解能(E/AE) : >1000

● 光子数: 10⁸~10⁹ (photons/sec)

軟 X線領域の吸収端近傍の X線吸収微細構造(XAFS)分光測定を行い、材料中の原子の結合状態や局所構造を解析する。エネルギー範囲としては $0.5 \sim 2 \text{keV}$ の光が利用でき、K 吸収端で酸素~シリコン、L 吸収端でクロム~臭素を対象とした、全電子収量法及び窓無し SDD による蛍光収量法を用いた XAFS 測定が可能である。さらに、半球型光電子アナライザ(SCIENTA R3000)も備えており、内殻の占有準位の光電子分光測定も可能である。測定チャンバにはロードロック及びサンプルバンクを備え、複数試料を導入することが可能である。また、トランスファーベッセルを装備しており、製造現場や実使用環境から大気非曝露で試料を導入することができる。なお、トランスファーベッセルとサンプルホルダーは BL6N1、BL7U と共通型であるため、大気非曝露での相互利用が可能である。





BL2S1(単結晶 X 線回折)

● 光エネルギー : 7~17 keV (波長: 0.18~0.07 nm)

● ビームサイズ : 0.18×0.19 mm

● 分解能(E/ΔE) : >2000@12 keV (計算値)

● 光子数(photons/sec): 1.9×10 ¹⁰ @ 11.1 keV, 8.0×10 ⁹ @ 16.5 keV

湾曲平板の垂直方向の集光ミラー(Pt コート)と、水平分散の非対称結晶三角分光器のビームラインで、Ge(111)と Ge(110)の分光結晶を交換して使い分けることで $7\sim17~keV$ ($0.18\sim0.07~nm$)の広い範囲を使用することが出来る(通常は 11.1~or 16.5~keV(1.12~or 0.75 Å)で運用)。単結晶 X 線回折装置は 20 光学台上に設置され、20 の回転範囲は $12.5\sim33.5~g$ である。試料結晶ゴニオは XYZ ステージ付き高精度高速回転軸ゴニオで、先端部は凍結タンパク質結晶用のクライオピンがそのまま磁石でマウント出来る標準的な構造である。また、ダイヤモンドアンビルセル(DAC)を使用する高圧実験ユーザーのために比較的小型の DAC が搭載可能なモードも設定している。検出器は二次元検出器(通常 ADSC Q315r,予備 PILATUS 1M)を備え、カメラ長(試料:検出器距離)は $90\sim342~mm$ で可変である。





単結晶 X 線回折装置

BL2S1 外観







BL2S1 の回折計のゴニオに 3 種類の DAC を搭載した様子

BL2S1の文献:

Watanabe, N., Nagae, T., Yamada, Y., Tomita, A., Matsugaki, N. & Tabuchi, M. "Protein crystallography beamline BL2S1 at the Aichi synchrotron" *J. Synchrotron Rad.* **24**, 338-343 (2017).

(2017年11月現在)

BL5S1 (硬 X 線 XAFS I)

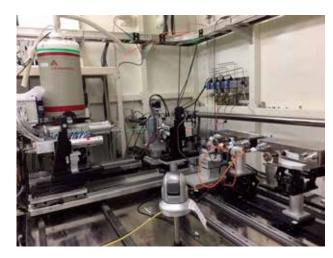
● 光エネルギー:5~20 keV (波長:0.25~0.06 nm)

● ビームサイズ: 0.50×0.50 mm (横×縦、通常集光時)

● 分解能(E/ΔE): >7000@12 kev (計算値)

● 光子数: 1.0×10¹¹ (photons/sec) @ 9 keV (分光結晶 Si(111))

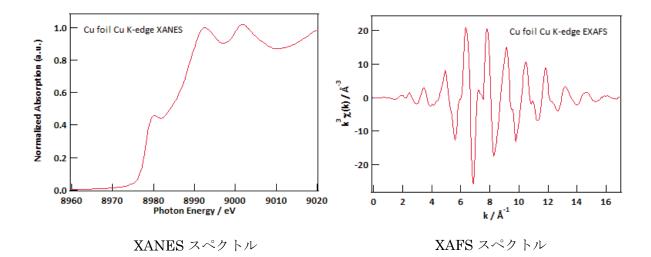
硬 X 線領域の X 線吸収微細構造(XAFS)測定を行い、材料中の原子の結合状態や局所構造を解析する。エネルギー範囲としては、K 吸収端でチタン(Ti)~ モリブデン(Mo)、L 吸収端でセシウム(Cs)~ラジウム(Ra)を対象とする。測定法として透過法以外に 19 素子 Ge-SSD、7 素子 SDD による蛍光法での測定、転換電子収量法が実行可能。測定モードではステップスキャンモード以外に、Quick XAFSモードでの短時間/時分割測定をサポート。実験ハッチ内に支燃性・可燃性排ガスの供給/排気ダクトを備え、試料加熱セル(~1000°C)、He 冷凍機(~10K)があり、測定対象の実使用環境における測定が可能。多数の試料の測定には自動試料交換装置を利用可能で一度の試料交換で 50 試料程度の測定実績あり。



10¹¹
10¹¹
10¹¹
10¹²
「仮エネルギー配置
通常配置
高エネルギー配置
10⁷ 5 10 15 20 25 Energy (keV)

BL5S1 測定系

BL5S1 光子数



Cu フォイルの K 吸収端分析

(2017年11月現在)

BL5S2(粉末 X 線回折)

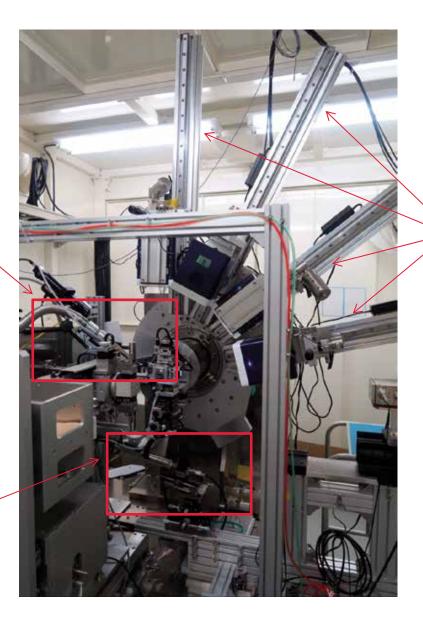
● 光エネルギー:5~23 keV(波長:0.25~0.053 nm)

● ビームサイズ: 0.5×0.5 mm

● 分解能(E/ΔE): 7000 @ 12 kev (計算値)

● 光子数:1×10¹¹ (photons/sec)@12 keV

粉末 X 線回折法により、物質の定性、定量、構造解析などを精度よく行う。検出器とし二次元半導体検出器(PILATUS 100K)4 台を有し、デバイ・シェラーリングを二次元画像として収集可能である。また PILATUS 100K 用の固定アームは、必要とされる角度分解能に応じて、カメラ長の変更(170~1000 mm)が可能である。さらに、試料温度設定用に高低温窒素ガス吹付装置(-130 \mathbb{C} ~550 \mathbb{C})を有する。支燃性・可燃性排ガスダクトを整備し、製造現場の実使用環境における測定をサポートする。



PILATUS 固定アーム

低温窒素ガス 吹付装置 へ

高温窒素ガス吹付装置

BL6N1 (軟 X 線 XAFS・光電子分光 I)

● 光エネルギー: 1.75~6 keV(波長: 0.7~0.2 nm)

● ビームサイズ: 2.0×1.0 mm

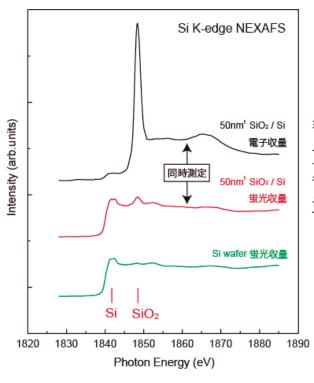
● 分解能(E/ΔE): >2000 @ 3 keV (計算値)

● 光子数: 1.5×10¹⁰ (photons/sec) @ 3 keV

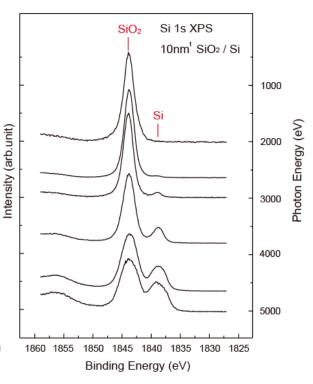
軟 X線領域の X線吸収微細構造分光(XAFS)及び X線光電子分光(XPS)測定により、材料中の原子の結合状態や局所構造を解析する。現在、測定可能なエネルギー領域は K吸収端で Si~Cr である。本ビームラインは大気圧下と超高真空下でそれぞれ実験が可能な、2 つの測定システムを有する。前者の測定システムでは、He 雰囲気下でシリコン半導体検出器による部分蛍光収量と転換電子収量の同時測定よる XAFS 測定が可能で、液体試料の測定や製造現場や材料の実使用時に近い環境での測定に対応している。一方、後者の測定システムでは、試料電流法による XAFS 測定や、静電半球型電子分光器(SPECS PHOIBOS 150)を用いた通常の実験室 X線源より高エネルギーの励起光による XPS 測定が可能で、トランスファーベッセルによる大気非暴露試料導入にも対応している。



BL6N1 外観



軟 X 線 XAFS スペクトル Si K 端



X線光電子分光スペクトル Si 1s

(2016年9月現在)

BL7U(真空紫外分光)

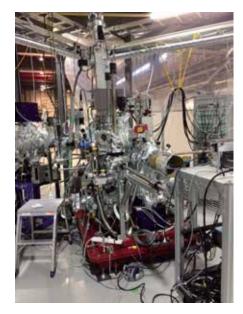
● 光エネルギー: 0.03~0.85 keV, (波長: 40~1.5 nm)

● ビームサイズ: 0.07×0.15 mm

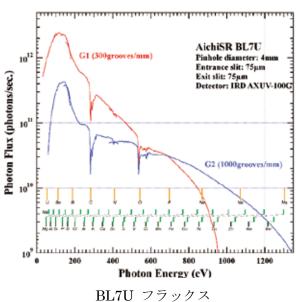
● 分解能(E/ΔE): >5000@200eV (計算値)

● 光子数: 2×10¹² (photons/sec) @ 100 eV

アンジュレータによる大強度の真空紫外/軟 X 線を用いた高分解能の吸収分光および内殻準位・価電子帯の光電子分光を行い、物質の化学状態・電子状態を詳細に分析する。エネルギー範囲としては、K 端でリチウム~ネオン、L 端でアルミニウム~ニッケル、M 端でウランまでをカバーする。高分解能の静電半球型光電子分光装置(MB SCIENTIFIC AB)と 2 次元位置検出器を備え、光電子スペクトルの角度依存性(角度分解光電子分光)を高効率に測定することができる。さらに、試料搬入系(試料バンク、準備槽)の工夫により、多数試料の多様な分析を迅速に行うことを可能とする。



BL7U エンドステーション



HOPG C K edge NAS p polarized light.

Incident Angle U deg.

45 deg.

75 deg.

Plintin Faiergy (eV)

Archish BLTV

HOP (高配向熱分解黒鉛) の分析結果 CK端

(2016年9月現在)

BL8S1 (薄膜 X 線回折)

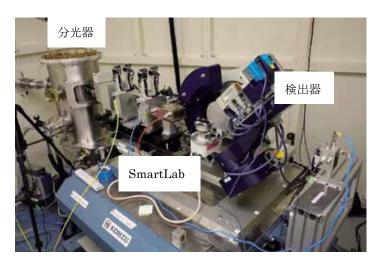
● 光エネルギー: 9.16, 14.3, 22.7 keV (波長: 0.135, 0.087, 0.055 nm)

● ビームサイズ: 0.8 mm×2.0 mm(幅×高さ)

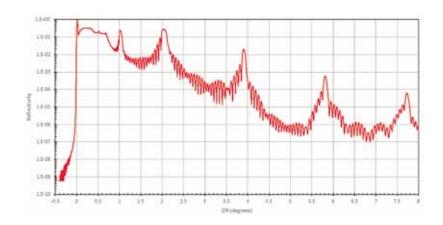
● 分解能(E/ΔE): >2000@12 kev (計算値)

● 光子数(単位: Photons/sec): 3.0×10¹⁰ @ 9.16 keV, 1.5×10¹⁰ @ 14.3 keV, 3.0×10⁹ @ 22.7 keV

有機・無機多層膜の X 線反射率測定や X 線回折、 X 線 CTR 散乱測定を迅速・簡便かつ精度よく行えるよう整備されたビームライン。BL8S1 は一結晶分光器を導入するため、回折装置は 20 光学台に設置される。分光結晶に Si(111)を使用した場合、利用可能なエネルギー範囲は 9.15 keV~14.4 keV、分光結晶に Si(311)を使用した場合、利用可能なエネルギー範囲は 18 keV~23 keV となる。回折装置はリガク製 SmartLab: 放射光仕様の改造機が整備されている。検出器としてシンチレーションカウンタの他に二次元半導体検出器(PILATUS100K)を備え、装置入射部には入射ビーム平行性向上のため二結晶または四結晶分光器が設置可能となっている。表面すれずれ入射条件を利用した薄膜評価や半導体薄膜の結晶性評価、構造変化の解析、応力測定、照射実験が可能である。



BL8S1 測定系外観 X線望遠鏡用多層膜ミラーの反射率測定



(2016年9月現在)

BL8S2 (トポグラフィ, LIGA, X線照射, X線 CT)

● 光エネルギー: 7-24 keV (波長: 1.8-0.5 Å)

● ビームサイズ: 40 mm×8 mm (水平方向× 垂直方向)

BL8S2(図 1 参照)では、パワー半導体(SiC や GaN 等)などの単結晶材料に内在する結晶欠陥を X線トポグラフィによる測定手法を用いて観察可能である(図 2 参照)。X線トポグラフィ像の取得は、原子核乾板、X線フィルム、CCD カメラ(ピクセルサイズ $5.4~\mu m \times 5.4~\mu m$)、フラットパネルセンサ (ピクセルサイズ $50~\mu m \times 50~\mu m$)を用いて行う。単色 X線と白色 X線を自由に切り替えて使用でき、試料位置における X線のビームサイズは $40~m m \times 8~m m$ (水平方向 \times 垂直方向)と大きいため、他の様々な手法の実験を実施することもできる。 X線リソグラフィを用いた構造物のマイクロ微細加工

(LIGA、図3参照)、試料を回転させつつ透過像を撮影し画像処理を行うことで3次元構造や断面構造を観察するX線コンピュータトモグラフィ(CT)測定(図4参照)、X線照射により植物等の突然変異を誘発して品種改良を行うX線照射実験が可能である。

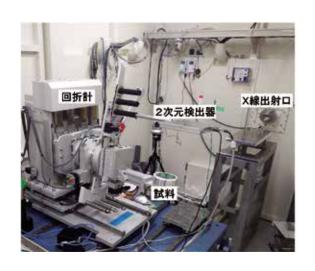


図 1 BL8S2 の実験ハッチ内の回折計

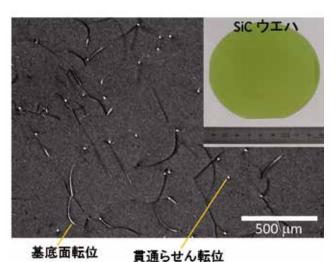


図2 SiCのX線トポグラフィ像(原子核乾板)

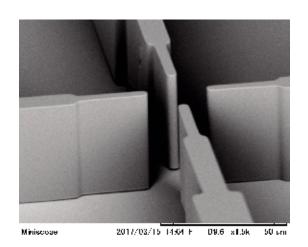


図3 LIGAにより作製されたマイクロ加工物

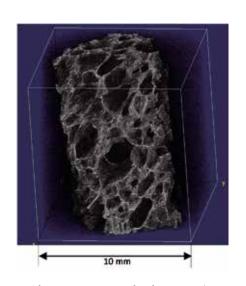


図4 X線CTによる、食パンの3次元CT像

(2017年11月現在)

BL8S3(広角・小角 X 線散乱)

● 光エネルギー: 8.2 & 13.5 keV (波長: 0.15 & 0.09 nm)

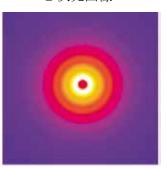
● ビームサイズ: 0.67×0.14 mm (計算値) ● 分解能(E/ΔE): >2000 @ 8.2 keV (計算値) ● 光子数: 3.3×10¹⁰ (photons/sec) @ 8.2 keV

X線小角散乱法により、分子薄膜や繊維など、主に有機・高分子材料の構造を解析する。数 Å から約 200 nm までの範囲の構造の測定が可能である。自動読取イメージングプレート検出器 (R-AXIS IV++) と二次元半導体検出器 (PILATUS 100K)を備え、高精度静的測定と時分割測定を可能とする。さらに フラットパネル検出器を併設することで小角と高角の同時測定を可能とする。いずれも2次元画像が得 られる都度、自動で1次元化が行われるソフトウェアが利用可能である。試料回りは、サンプルチェン ジャー、試料加熱冷却装置を備える。カメラ長は最大4mとし、試料位置に自由度を持たせることでユ ーザー持ち込みの大型な試料環境装置にも対応する。また、薄膜由来の小角散乱である GI-SAXS も可 能となっている。

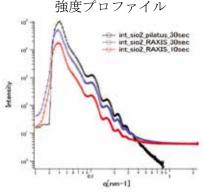
(カメラ長:4 m) レイアウト



小角散乱測定例 2 次元画像



強度プロファイル

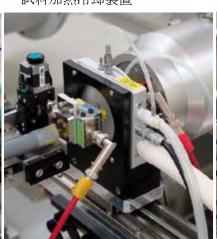


100 nm SiO₂粉末分散液 (X 線波長:1.5 A)

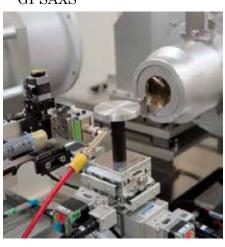
小角 • 広角同時測定



試料加熱冷却装置



GI-SAXS



(2017年9月現在)

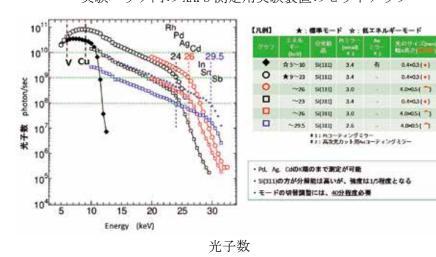
BL11S2 (硬 X 線 XAFS II)

- 光エネルギー: Si(111)5~26.5 keV (波長: 0.25~0.047 nm)、Si(311) 10~29.5 keV (波長: 0.12~0.041 nm)
- ビームサイズ: 0.40×0.25 mm (横×縦、通常集光時)
- 分解能(E/ΔE): >7000@12 kev (計算値)
- 光子数: 8×10¹⁰ (photons/sec) @ 9 keV (分光結晶 Si(111))、1.5×10¹⁰ (photons/sec) @10 keV (分光結晶 Si(311))

硬 X線領域の X線吸収微細構造 (XAFS) 測定を行い、材料中の原子の結合状態や局所構造を解析する。ビームライン全般に BL5S1 とほぼ同等のスペックを満たし硬 X線 XAFS 測定の高い需要に応えることに加えて、より高エネルギー側での利用をサポートする。Si(111)分光結晶使用時は 26.5 keV までの利用を想定。(Pd, Ag, Cd OK-吸収端)の測定実績あり。ビームライン組込の高次光除去ミラーを備え、低エネルギーの測定も安定して実行可能。測定法として透過法、蛍光法、転換電子収量法が利用可能なことや、実使用環境測定をサポートするガス供給/排気系を備えることは BL5S1 と同等。 さらに試料加熱・冷凍装置等ほとんどの実験装置を BL5S1 と共有するため、BL5S1 で可能な実験は全てサポートした上で測定可能元素の範囲が広がったビームラインとなる予定。



実験ハッチ内の XAFS 測定用実験装置のセットアップ







上: 実使用環境測定用 ガス供給系

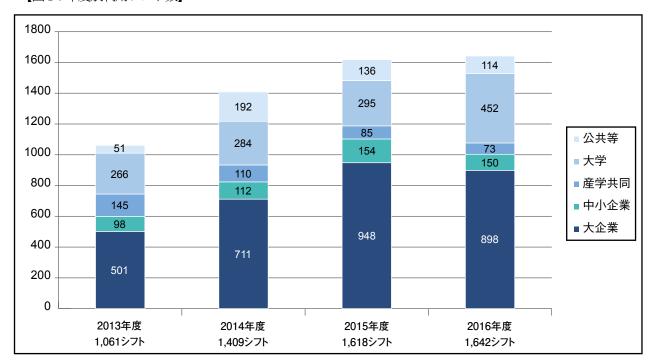
下: イオンチャンバ用 ガス供給系

2. ユーザー利用実績



2.1 概況

- ○2016 年度利用数は、1,642 シフト(1 シフト=4 時間)で、2015 年度(1,618 シフト)と比べ微増となった。
- ○また、現在までに 256 のユーザー(企業は 189 社、うち中小企業 68 社 (36.0%)) が利用しているが、新規ユーザーは 2014 年度が 53、2015 年度が 47、2016 年度が 54 と利用企業等の裾野は徐々に拡大している。
- ○比較的利用の少なかったビームラインを中心に成果公開無償利用制度による活用事例の抽出・情報発信を行うとともに、研究会を開催し、新規ユーザーの開拓に努めた。



【図1:年度別利用シフト数】

2.2 利用状况·推移

○2013 年度の平均利用率は63.8%、2014 年度は78.4%、2015 年度は81.2%、2016 年度は88.5%という状況である。

その理由として、100%の利用率が続いている4本のビームライン (BL5S1、BL5S2、BL6N1、BL7U) に加え、比較的利用の少なかったビームライン (BL8S1、BL8S3) の利用が増加してきたことが挙げられる。

○利用申込が、常時、超過状態であった硬X線XAFSビームライン (BL5S1) については、2016年 1月から新たな硬X線XAFSビームライン (BL11S2) の供用を開始したことで、申し込みが分散 し超過状態の改善が図られた。

- 利用者の構成【2016年度】(図2)
- ・産業利用は、全体の65% (大企業55%、中小企業6%、産学共同利用4%) を占めている。
- ・産業利用の比率は、他施設と比べて高い割合となっている。
- 地域別企業ユーザーの利用状況【2016年度】 (図3)
 - ・県内企業の利用件数は、全体の58%を占め、愛知県を含めた中部地域の利用は64%となっている。
- ・一方、全国的に知名度が高まったためか、関東地域は22%、近畿地域は13%と昨年度と比べ増加している。
- 産業分野別利用状況 【2016年度】(図4)
- ・利用企業の業種は、輸送用機器が最も多い45%を占めている。
- ・その他、窯業、電子部品、化学、ヘルスケアなど幅広い産業分野に活用されている。

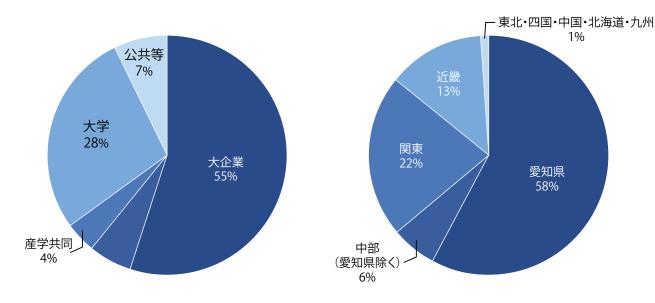


図2、利用者の構成

図3、地域別企業ユーザー

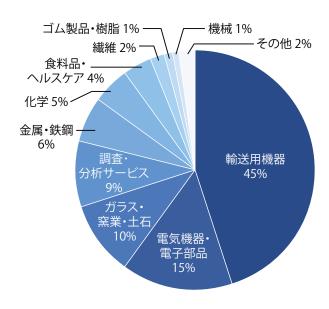


図4、産業分野別利用状況